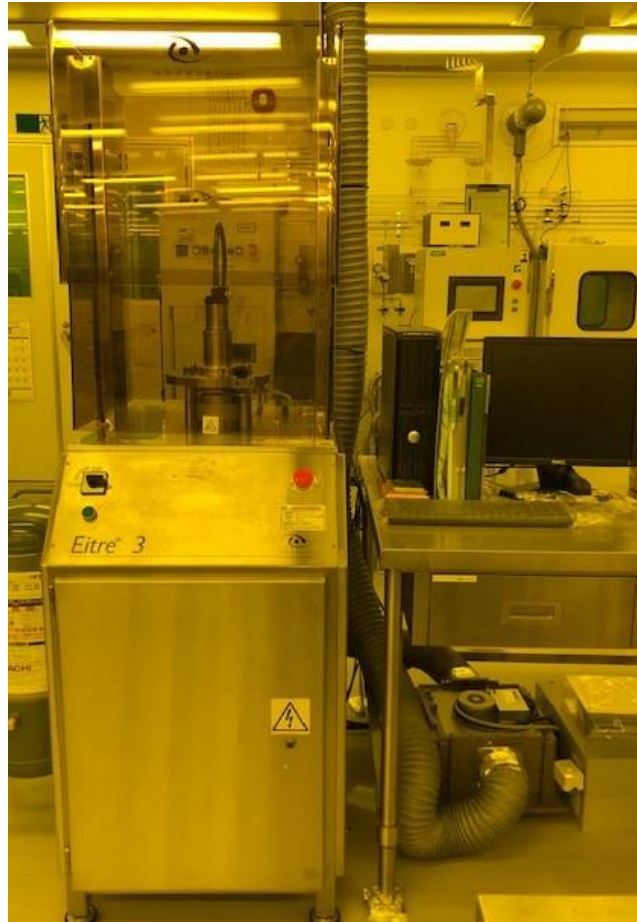


ナノインプリント装置

Obducat 社製 Eitre3



UV および熱インプリント（同時使用可）

空気圧を使用してスタンプと基板に圧力が加えられ、インプリント領域全体に均一にパターン転写可能（試料サイズがある程度の大きさがある場合）

加熱温度： 室温～200℃ 加圧： 10～50bar

波長： 365nm, 405nm, 436nm (その他波長はフィルターでカット)

試料サイズ： ～Φ3 インチ

試料厚み： ～2mm

設置場所： 産業科学研究所 ナノテク棟 4F- N415

装置担当： 先端機器室 佐久間